

# Kundenspezifischer Ptfе Labor-Reinigungskorbträger

## Hochreiner Säure-Beständiger Wafer-Halter Niedrige Hintergrundkontamination Freies Chemikalienbad-Gestell

Artikelnummer: PL-CP268



### Einführung

Entdecken Sie hochreine, kundenspezifische PTFE-Reinigungskorbträger für Halbleiter- und Spurenanalysen. Diese säurebeständigen Gestelle gewährleisten kein Auslaugen und ultraniedrige Hintergrundwerte und bieten zuverlässige Leistung in den anspruchsvollsten chemischen Umgebungen für präzise Laborreinigungsprozesse.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Halbleiter-Waferreinigung	Sicheres Halten von Siliziumwafern während RCA-Reinigung oder HF-Ätzprozessen in Reinraumumgebungen.	Verhindert metallische Kontamination und gewährleistet gleichmäßige chemische Exposition.
Spuremetallanalyse	Reinigung und Auslaugen von Laborgeräten für die ICP-OES- und ICP-MS-Probenvorbereitung, um ppt-Reinheit zu erreichen.	Beseitigt Hintergrundinterferenzen durch das Gefäßmaterial selbst.
Batterieforschung	Handhabung von Anoden- und Kathodenmaterialien während Elektrolyt-Immersion oder chemischer Behandlungsphasen.	Beständigkeit gegen aggressive organische Lösungsmittel und Lithiumsalze.
Pharmazeutische Sterilisation	Transport von Glasfläschchen oder Präzisionskomponenten durch Hochtemperatur- oder chemisch aggressive Sterilisationszyklen.	Erhält die Reinheit und verhindert die Oberflächenadsorption von Wirkstoffen.
Entfettung von Luft- und Raumfahrtkomponenten	Halten von präzisionsgefertigten Legierungsteilen während Tiefenreinigungszyklen in scharfen chemischen Entfettungsmitteln.	Langzeitbeständigkeit in industriell starken Reinigungsreaktionen.
Solarzellenfertigung	Unterstützung von Photovoltaik-Substraten während nasschemischer Verarbeitungs- und Texturierungsstufen.	Hohe Temperaturbeständigkeit und chemische Kompatibilität mit Ätzmitteln.
Geologische Probenvorbereitung	Aufschluss und Reinigung von Mineralproben mit konzentrierter Flusssäure zur Elementbestimmung.	Sichere Handhabung in gefährlichen Säureumgebungen ohne Gefäßdegradation.
Spezifikationskategorie	Parameterdetails für PL-CP268	Werte / Fähigkeiten
<b>Materialeigenschaften</b>	Primäres Konstruktionsmaterial	Neues Hochreines PTFE (Polytetrafluorethylen)
	Spurenelement-Hintergrund	Ultraniedrig (Geeignet für ppt-Analyse)
	Chemikalienbeständigkeit	Universell (Außer geschmolzene Alkalimetalle/Fluor)
	Wasseraufnahme	<0,01 %
<b>Physikalische Abmessungen</b>	Konfiguration	Vollständig an Kundenspezifikationen anpassbar
	Größenoptionen	Maßgeschneiderte Designs für 2", 4", 6", 8", 12" Wafer oder kundenspezifische Laborgeräte
	Handhabungsmerkmale	Optionale integrierte Griffe, ausfahrbare Arme oder verschließbare Deckel
<b>Thermische Grenzwerte</b>	Maximale Betriebstemperatur	260°C (500°F)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
<b>Spezifikationskategorie</b>	<b>Parameterdetails für PL-CP268</b>	<b>Werte / Fähigkeiten</b>
	Minimale Betriebstemperatur	-200°C (-328°F)
<b>Fertigungsdetails</b>	Herstellungsmethode	Hochpräzisions-CNC-Bearbeitung
	Oberflächenrauheit	Ra 0,4 - 0,8 µm (Standard) / Polierte Optionen verfügbar
	Artikelnummer Referenz	PL-CP268